

2024年7月期 第2四半期 決算説明会

サムコ株式会社

証券コード: 6387 東証プライム

24/7月期 第2Qの実績

(2023.8.1 ~ 2024.1.31)

24/7月期第2四半期 業績ハイライト

過去最高	過去最高	過去最高	過去最高
売上高	営業利益	経常利益	中間純利益
41.0億円	10.1億円	10.6億円	7.4億円

- 増収・増益
- 売上高は計画45.2億円に対し、41.0億円(△4.2億円)、下半期で挽回予定
- 売上高、営業利益、経常利益、中間純利益は4期連続で過去最高を更新
- 受注高は第2四半期累計36.6億円(前年同期比△19.1%)であるが、第2四半期単体は23.0億円と回復基調。
- 受注残高49.7億円。(前年同期比△12.8%)

24/7月期第2Q(累計) 実績報告

(単位: 百万円)

	23/7月期 2Q実績	24/7月期2Q			
		実績	前年同期比	当初計画	当初計画比
売上高	3,848	4,105	6.7 %	4,520	△ 9.2 %
売上総利益	1,950	2,052	5.3 %	2,200	△ 6.7 %
売上高総利益率	50.7 %	50.0 %	—	48.7 %	—
営業利益	964	1,012	5.1 %	1,140	△ 11.2 %
営業利益率	25.0 %	24.7 %	—	25.2 %	—
経常利益	982	1,063	8.3 %	1,150	△ 7.5 %
当期純利益	700	747	6.7 %	780	△ 4.2 %

- 第2四半期累計期間の売上高・各利益は過去最高も、当初計画には若干届かず。
- 原材料価格の上昇はあるものの、原価低減や操業度向上などにより、売上高総利益率は高水準を維持。

24/7月期第2Q 装置別売上高

(単位:百万円)

	23/7月期2Q		24/7月期2Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
CVD装置	797	20.7 %	795	△ 0.2 %	19.4 %
エッチング装置	1,881	48.9 %	2,363	25.6 %	57.6 %
洗浄装置	366	9.5 %	366	△ 0.2 %	8.9 %
部品・メンテナンス	803	20.9 %	580	△ 27.8 %	14.1 %
合計	3,848	100.0 %	4,105	6.7 %	100.0 %

【CVD装置】 高周波デバイス向けや半導体レーザー向け(化合物半導体)での販売。

【エッチング装置】 高周波デバイス向け、半導体レーザー向け、パワーデバイス向け(化合物半導体)、欠陥解析向け(シリコン半導体)での販売。

【洗浄装置】 高周波デバイス向けや半導体レーザー向け(化合物半導体)での販売。

24/7月期第2Q 用途別売上高

(単位:百万円)

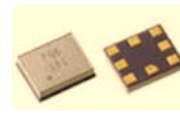
	23/7月期2Q		24/7月期2Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
化合物半導体分野	1,228	31.9 %	1,722	40.2 %	40.2 %
シリコン半導体分野	535	13.9 %	798	49.2 %	19.4 %
電子部品分野	534	13.9 %	159	△ 70.1 %	3.9 %
ヘルスケア関連分野	48	1.3 %	23	△ 52.4 %	0.6 %
その他	697	18.1 %	821	17.7 %	20.0 %
部品・メンテナンス	803	20.9 %	580	△ 27.8 %	14.1 %
合計	3,848	100.0 %	4,105	6.7 %	100.0 %

当第2四半期決算より、当社の事業形態を分かりやすく反映させるため、用途区分を変更しております。
(詳細は次ページ参照ください)

用途別売上高区分

当第2四半期決算より区分を変更しております

用 途	概 要
化合物半導体分野	GaN(窒化ガリウム)、GaAs(ガリウムヒ素)、InP(インジウムリン)、SiC(炭化シリコン)などの化合物を材料に用いた半導体デバイスの加工用途です。化合物半導体はLEDや半導体レーザーといった光デバイス、電力の制御や増幅に使われるパワーデバイスや高速通信を実現するHEMT(High Electron Mobility Transistor)などの高周波デバイスに用いられます。
シリコン半導体分野	シリコンウェハの欠陥解析及びシリコン半導体に関する加工用途です。
電子部品分野	半導体を除く電子部品の加工用途です。主にMEMS(Micro Electro Mechanical Systems 微小電気機械システム)、コンデンサ、インダクタ、各種センサー、高周波フィルターが含まれます。
ヘルスケア関連分野	マイクロ流体デバイスなどヘルスケアに関する加工用途などです。
その他	大学等の共用設備向けの装置など上記以外の加工用途です。
部品・メンテナンス	部品・メンテナンスに関する売上であります。



第45期第2四半期 決算短信(2024.3.13提出)より

24/7月期第2Q 目的別売上高

(単位: 百万円)

	23/7月期2Q		24/7月期2Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
生産用	1,704	44.3 %	1,327	△ 22.1 %	32.4 %
研究開発用	1,340	34.8 %	2,197	63.9 %	53.5 %
部品・メンテナンス	803	20.9 %	580	△ 27.8 %	14.1 %
合計	3,848	100.0 %	4,105	6.7 %	100.0 %

【生産用】 エッチング装置を中心に、半導体レーザー、欠陥解析向けなどで販売。

【研究開発用】 半導体レーザー、高周波デバイス、パワーデバイス、多目的研究開発、共用設備への販売。
出荷延期となっていた大口受注(約800百万円)を出荷完了。

24/7月期第2Q 地域別売上高

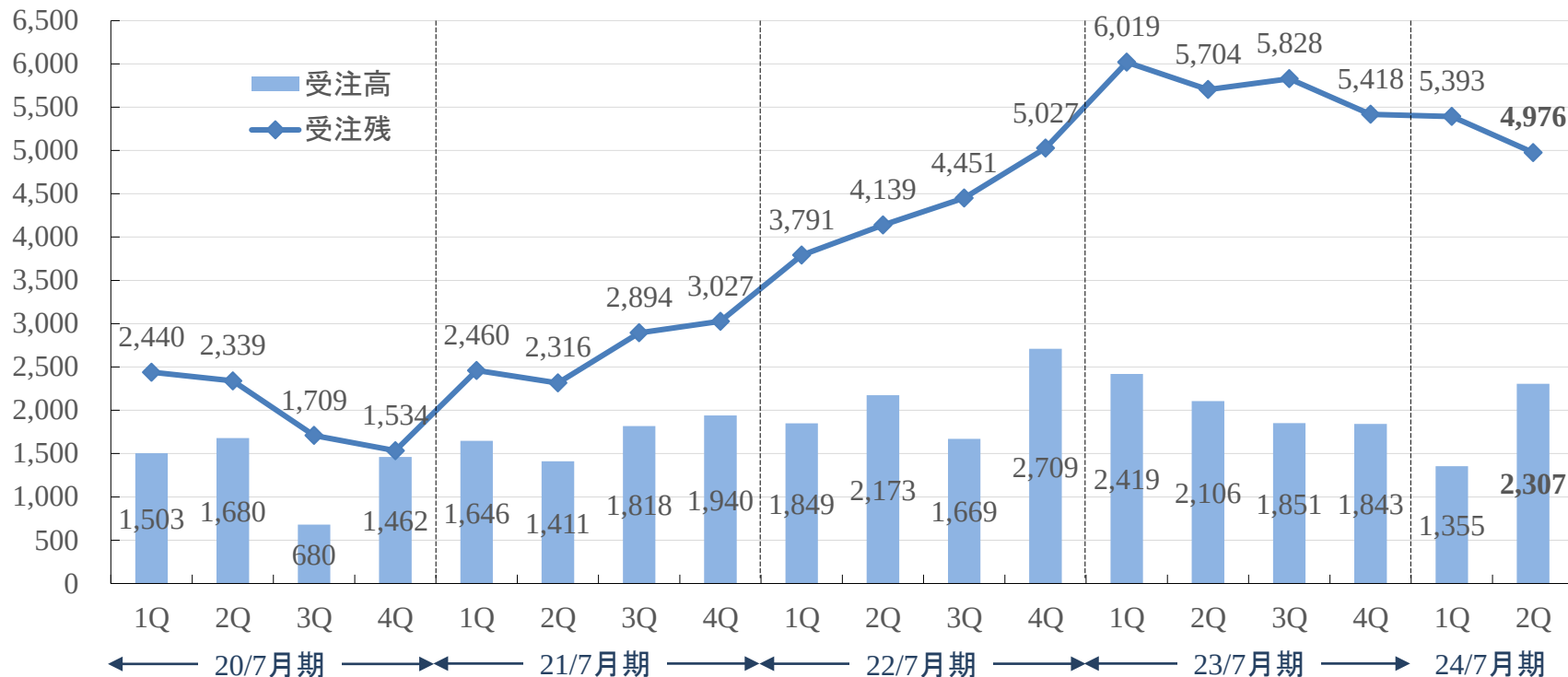
(単位: 百万円)

	23/7月期2Q		24/7月期2Q		
	売上高	構成比	売上高	前年同期比	構成比
(国内)	2,411	62.7 %	2,542	5.4 %	61.9 %
(海外合計)	1,437	37.3 %	1,563	8.7 %	38.1 %
アジア	1,084	28.2 %	1,160	7.0 %	28.3 %
北米	294	7.6 %	399	35.8 %	9.7 %
欧州	58	1.5 %	2	△ 95.3 %	0.1 %
その他	—	—	0	—	0.0 %
合計	3,848	100.0 %	4,105	6.7 %	100.0 %

- 海外売上高比率 38.1%(通期計画43.4%)。
- アジア市場: 中国778百万円、韓国218百万円、台湾88百万円、以下インド、フィリピンほか。
- 北米市場 : コロナ後の落ち込みから挽回。

受注環境(受注高、受注残高)の変化

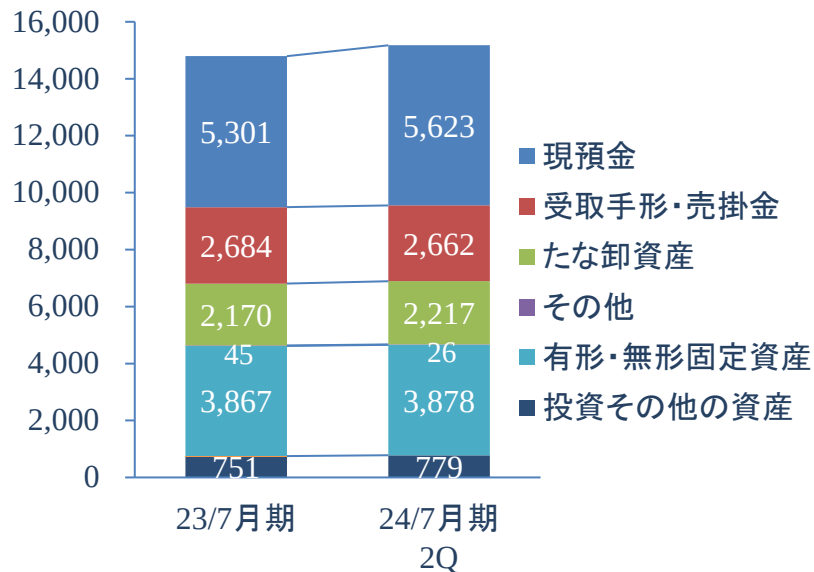
(単位: 百万円)



貸借対照表(前事業年度末比)

(単位:百万円)

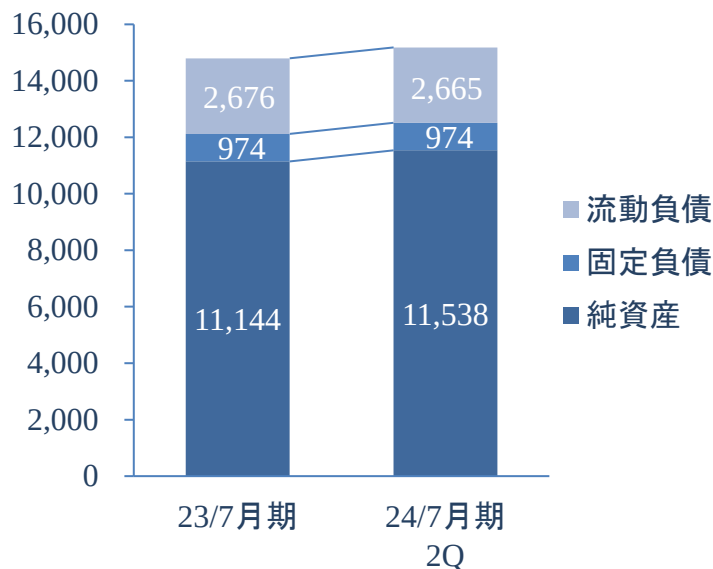
資産



- ・ 現金及び預金 321百万円増
- ・ 受取手形・売掛金 22百万円減
- ・ たな卸資産 46百万円増

(単位:百万円)

負債・純資産



- ・ 買掛金 39百万円減
- ・ 未払法人税等 66百万円増
- ・ 契約負債 116百万円増
- ・ 繰越利益剰余金 385百万円増

キャッシュフロー計算書(前年同期比)

(単位:百万円)

	23/7月期 2Q	24/7月期 2Q	前年同期比	24/7月期 2Qの主な内訳
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,068	722	1,790	税引前利益+1,063、 法人税等の支払額又は還付額 △381
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 64	△ 44	22	定期預金の払戻+1,445 定期預金の預入△1,451、保険積立金の積立による 支出△20、有形固定資産の取得△17
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 303	△ 382	△ 78	配当金の支払△361
現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 1	9	11	—
現金及び現金同等物の増減額	△ 1,438	307	1,745	—
現金及び現金同等物の期首残高	3,919	3,374	△ 545	—
現金及び現金同等物の期末残高	2,481	3,681	1,200	—

24/7月期 第2Q トピックス

(2023.8.1 ~ 2024.1.31)

第三研究開発棟新設を決定



第三研究開発棟 完成イメージ

本社(京都市伏見区)周辺に「第三研究開発棟」を新設し、2024年12月から運営を開始することを決定。

化合物半導体の市場の広がりに伴い生産が本格化するSiCパワーデバイス、GaNパワー/RFデバイス、GaAs VCSEL、MEMS、高周波フィルターなどの分野で高度化するニーズに応えるため、最先端の設備を用意。

【第三研究開発棟 概要】

所在地 京都市伏見区竹田田中宮町93番(現研究開発センター隣接)
建物概要 地上2階建て、鉄骨造。延床面積:約850平方メートル
建設計画 2024年5月着工、2024年12月完成(予定)
施設構成 研究開発棟(1階:研究施設、2階:事務所)

詳しい情報は[こちら](#)

東スイス応用科学大学との連携を開始、欧州市場の開拓を強化



海外販売の拡大のため、東スイス応用科学大学(Ost Schweizer Fachhochschule: OST)との連携を開始し、欧州市場の開拓を強化。

当社はCCP型RIE装置「RIE-10NR」と卓上型UVオゾンクリーナー「UV-2」をOSTのマイクロテクノロジー・フォトンクス研究所(Institute for Microtechnology and Photonics: IMP)に設置し、オープンラボとして欧州中の大学や企業の研究者にご利用いただきます。

今回のOSTとの連携をきっかけに、欧州で当社およびsamco-ucp社の装置の販売を強化してまいります。

左: OST IMPクリーンルームの責任者 Dr. Marco Cucinelli

右: samco-ucp社 新CEO Vinzenz Gangl

[詳しい情報はこちら](#)

「RIE-10NR」販売累計500台を達成



理化学研究所 山本チームリーダー(右から2人目)

研究開発用CCP(Capacitively Coupled Plasma:容量結合プラズマ)型RIE装置「RIE-10NR」が累計販売台数500台を達成。

500台目のRIE-10NRをご導入いただいた理化学研究所 量子電子デバイス研究チームの山本倫久チームリーダーを訪ね、当社代表取締役社長の川邊が謝意を伝え、記念品を進呈。

RIE-10NRは、1995年12月に販売を開始して以来、国内外の大学、研究機関、企業に選ばれ続け、シンプルでコンパクトな装置コンセプトはそのままに、安全性や使いやすさなどの面で改善を重ね、研究開発用CCP-RIE装置のデファクトスタンダード機として国内外で活躍しています。

詳しい情報は[こちら](#)



マルチチャンバープラズマCVD装置「PD-2203LC」の販売を開始



最大3反応室搭載可能なマルチチャンバープラズマCVD装置「PD-2203LC」を開発、販売を開始。

実績豊富なCVD装置「PD-220NL」の反応室(Reaction Chamber: RC)を3つ備えた装置。真空カセット室と大気カセット室が選択可能で、ウェハー直接搬送の場合は真空カセットを、トレイ搬送の場合はプロセス後大気中で放熱が促進されるため大気カセットを推奨。

研究用途としては、それぞれの反応室で異なる膜種の成膜を実施することで、コンタミなどの影響を抑制可。生産用途においては、同じ膜種を3つの反応室で同時処理することで、1カセットあたりのタクトタイムを短縮することが可能。

詳しい情報は[こちら](#)

24/7月期第2Q トピックス



SEMICON Japan 2023出展

- 2023年12月23日～15日、東京ビッグサイトに開催。
- 出展社数は800社、延べ来場者数は85,000人。
- TBS「ひるおび」で当社の映像が流れました。



弊社ブースの様子
(東京ビッグサイト)

SEMICON Taiwan 2023出展

- 2023年9月6日～8日、台湾にて開催。
- 出展社数は950社、延べ来場者数は62,000人。



社員一同

展示会出展予定の情報は[こちら](#)

24/7月期第2Q トピックス (ESG・サステナビリティ関連)



- ・ESG委員会の活動による気候変動への対応状況把握、対策。
- ・TCFD提言に基づいた情報(温室効果ガス排出量等)を開示。
- ・主な取り組みテーマ：①製品容積の減少、②消費エネルギーの削減、③会社消費電力量の削減、④グリーン調達、⑤廃棄物の削減



- ・サムコ科学技術振興財団による活動
⇒2023年9月 第7回研究助成金贈呈式開催。ネオジム磁石の発明者である大同特殊鋼株式会社顧問、NDFEB株式会社 代表取締役の佐川真人様の記念講演開催。
- ・役員と従業員より、日本赤十字社「令和6年能登半島地震災害義援金」へ寄付。
- ・東高瀬川ビジネスパーク構想の策定委員会に参画。2024年3月より「東高瀬川ビジネスコミュニティ」発足(予定)。
- ・代表取締役会長 辻による京都内の大学での講義、京都府・京都市など地元産業のフォーラムに参加。



- ・決算短信、招集通知の英文開示。(前々期より対応)
- ・独立社外取締役3分の1以上。(昨年10月総会以降)
- ・女性活躍推進法に基づく行動計画及び数値目標、サムコの人材育成方針を当社HPに公開。
- ・人材教育の一環として社外取締役による社内講演を実施。

直近の社外イベント等



京都半導体産業振興フォーラム

半導体産業の展望と京都の可能性

基調講演 **松波 弘之** 京都大学名誉教授
パネラー サムコ(株)、(株)SCREEN HD 他 (調整中)
モデレータ 西本 清一 (公財)京都高度技術研究所 理事長

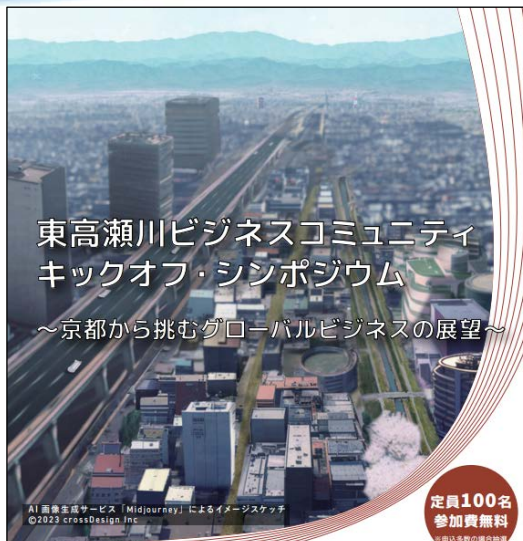
日時 **2024.3.13 水 15:00-17:00**
会場 京都リサーチパーク 4号館 バズホール
主催 京都府、京都産業21

京都半導体産業振興フォーラム:半導体産業の展望と京都の可能性

主催：京都府、公益財団法人京都産業21

<https://www.ki21.jp/informations/kyotosemiconforum/>

直近の社外イベント等



東高瀬川ビジネスコミュニティ
キックオフ・シンポジウム
～京都から挑むグローバルビジネスの展望～

AI 画像生成サービス「Midjourney」によるイメージスケッチ
©2023 crossDesign Inc.

定員100名
参加費無料
※申込多数の場合は抽選

京都の新たな産業活力を生み出す「らくなん進都」のコアとなる「東高瀬川ビジネスパーク」。その実現に向けて、この度、東高瀬川界隈で事業を営む我々企業人が中心となり、大学や行政、金融機関などと連携する「東高瀬川ビジネスコミュニティ」を発足しました。我々は、このまちに立地する企業の成長と共に、「らくなん進都」のまちづくりをリードすることを目指し、志を共有できる企業経営者や事業者・専門家等に、当コミュニティへの参加を求めています。そこで、我々が提案する「東高瀬川ビジネスパーク構想」や、「東高瀬川ビジネスパーク」の今後の展望等について皆さんと共有し、共に考えていくためのシンポジウムを開催します。

**2024
3.18 (月)**
15:00～17:00
(14:30～受付開始)
会場：京都市成長産業創造センター (ACT京都) 2階共通会議室

【主催】東高瀬川ビジネスコミュニティ（代表：サムコ株式会社 代表取締役会長 辻理）

プログラム

15:00 ①開会挨拶
平尾 一之 氏 京都市成長産業創造センターセンター長 / 京都大学名誉教授

15:10 ②「東高瀬川ビジネスパーク構想」とビジネスコミュニティの紹介
辻 理 氏 サムコ株式会社 代表取締役会長

15:20 ③記念講演「京都から挑むグローバルビジネスの展望」
辻 理 氏 サムコ株式会社 代表取締役会長
京都府出身。立命館大学理工学部卒業後、分析機器メーカー入社。米国 NASA Ames 研究所研究員等を経て 1979 年米国サムコインターナショナル研究所（現サムコ）設立。2018 年に代表取締役会長に就任。専門のプラズマ材料化学以外にイベントチャーター精神や国際的な人材育成等で活躍中。

15:50 ④パネルディスカッション「らくなん進都の可能性と東高瀬川IBPの展望」
※近所に追加、下記メンバーで行います。

平尾 一之 氏【ファシリテーター】
京都市成長産業創造センターセンター長 / 京都大学名誉教授
大阪市出身。京都大学工学研究科博士課程修了後、米国ボストン、京大助教、同教授を経て、現在、同名誉教授。日本セラミックス協会食費や国際ガラス学会の日本代表等を務める。2012 年第 5 回日本セラミックス協会功績大賞等。

生田 泰宏 氏
生田産機工業株式会社 代表取締役
京都市出身。大学卒業後、米国留学。他社勤務を経て、1989 年生田産機工業に入社。1999 年より現職。同社はメタルプロセスラインの製造・販売を中心に事業を展開。現在、日本・中国・トルコのグループ会社を含む 8 社の代表を務める。

竹田 正俊 氏
株式会社クロスエフェクト 代表取締役
京都市出身。立命館大学卒業後、米国に留学。2000 年クロスエフェクト創業。南南ジュエレーション中心でデジタルの展開、販売を手掛ける。2013 年第 5 回および日本大電内閣総理大臣賞、グッドデザイン賞受賞。2020 年京都創造者賞受賞等。

白須 正 氏
龍谷大学 研究フェロー
京都市生まれ。京都大学法学部卒業。大阪市立大学大学院創造学研究所研究科終了。1978 年京都府役所入庁。2011 年産業観光局長、2014 年産業戦略監、2016 年龍谷大政策学部長。専門は地域産業政策や地域産業振興策。

17:00 ⑤交流会 ※別途参加費 3,000 円（事前申込制）
※交流会は京都市成長産業創造センター（ACT京都）1階アトリウムにて開催

お申込みはこちら

下記URLもしくは、二次元コードから
お申込みください
<https://forms.gle/kKecYSPdudmLm8Q8>
※申込み締切：3/13(水) 17:00まで



会場アクセス

駐車場が併設されていますが、駐車台数には限りがあります。場合によっては、駐車できない可能性があるので、予めご留意ください。



【備後】東高瀬川ビジネスコミュニティ事務局
株式会社 地域計画推進研究所(アルパック) (和馬・内中・美濃)
〒600-8006 京都市下京区西橋町南橋西入立内中之町99番地 tel: 075-221-5132 mail: taken.kn@arpak.co.jp

東高瀬川ビジネスコミュニティキックオフ・シンポジウム
～京都から挑むグローバルビジネスの展望～
主催：東高瀬川ビジネスコミュニティ
<https://www.arpak.co.jp/event/item6451.html>

直近の社外イベント等

九州工業大学マイクロ化総合技術センターの半導体人材育成セミナーを経団連の十倉雅和会長が視察（2024年3月5日）



経団連会長 九州工業大の半導体研究施設を視察「技術者育てる起点になってほしい」
(TNCテレビ西日本) - Yahoo!ニュース

【半導体】九工大の人材育成施設を経団連会長が視察 学生や企業など全国から研修を受け入れ 福岡 | 福岡・佐賀のニュース | FBS 福岡放送

国を挙げて「半導体産業」育成...経団連の十倉会長が教育現場に - RKBオンライン

九州の半導体産業が注目される中、経団連の戸倉会長が九州工業大学マイクロ化総合技術センターで開かれている半導体人材育成セミナーを視察。
当社は、複数台のCVD装置・エッチング装置を納入しており、その様子が各メディアで報道されました。

国立大学法人九州工業大学 マイクロ化総合技術センター | 半導体・微細加工によるデバイス開発の製造・設計の一貫した設備を要するオープンな施設 (kyutech.ac.jp)

24/7月期事業計画

(2023.8.1 ~ 2024.7.31)

中期経営計画 目標数値

(単位: 百万円)

	23/7月期 実績	24/7月期 計画			25/7月期 計画
		上半期 実績	下半期 計画	通期	
売上高	7,830	4,105	4,394	8,500	11,000
売上総利益	3,869	2,052	2,072	4,125	5,180
営業利益	1,858	1,012	977	1,990	2,600
経常利益	1,927	1,063	946	2,010	2,610
当期純利益	1,366	747	622	1,370	1,780
海外売上高比率	34.3 %			43.4 %	45.5 %
R O E	12.9 %			11.8 %	13.8 %
1株当たり当期純利益(円)	170.07			170.56	221.4

24/7月期の課題と進捗状況

- ① クラスターツールシステムの拡販 ⇒ 初号機の出荷、納入完了
- ② 海外販売の拡大 ⇒ 海外売上比率 38.1%、引き続き海外展開に注力
- ③ 生産体制の拡充 ⇒ 土地・建屋の活用に向けた施策等を検討中
- ④ 成膜装置販売の強化（ナノ薄膜事業） ⇒ ALD装置の新製品を拡販強化
- ⑤ 新規事業の立ち上げ（ヘルスケア事業部） ⇒ コア技術を展開すべく注力
- ⑥ 更なる成長に向けた人材育成・活用 ⇒ 若手人材の育成、シニア社員の活躍
- ⑦ 環境対策（サムコ環境方針）への取り組み強化 ⇒ 省エネ化へ取り組み

今後の見通し

(単位: 百万円)

	売上高	前年同期比	見通し
化合物半導体分野	1,722	+ 40.2 %	半導体レーザー、フォトダイオード、次世代パワーデバイス用途が引き続き好調
シリコン半導体分野	798	+ 49.2 %	欠陥解析、シリコンフォトリソ、量子デバイス用途での引き合い
電子部品分野	159	△ 70.1 %	MEMS、高周波フィルター、コンデンサー、各種センサー向けなど動き出す
ヘルスケア関連分野	23	△ 52.4 %	マイクロ流路等ライフサイエンス向けの研究・開発段階
その他	821	+ 17.7 %	共用設備、半導体教育設備など向けの需要が堅調
部品・メンテナンス	580	△ 27.8 %	部材調達難が収束したため正常化

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応

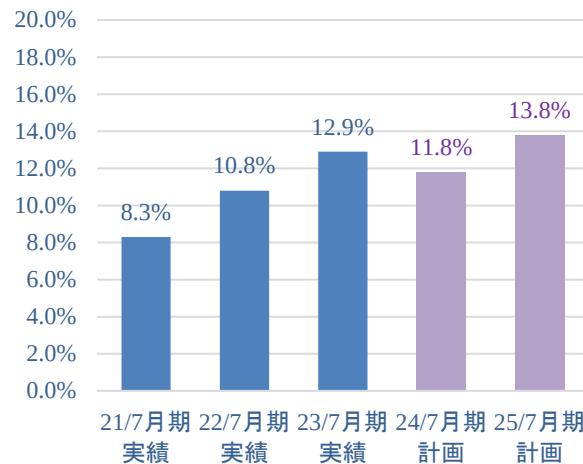
当社は、中長期的な経営指標として「装置製造原価率50%未満」「売上高営業利益率20%以上」「海外売上高比率50%以上」を掲げ、収益性と成長性を重視した経営の実現に向け対応しております。

当社の2023年7月期(第44期)のROEは12.9%であり、第45期には11.8%、第46期には13.8%とする計画であります。また、「資本コスト」については、その概念や計算方法について統一的な基準が示されておらず、一般的な指標になっていないことより、当社の経営指標や開示情報には用いておりませんが、新規事業等への新たな投資については現状のROE水準を意識した経営を実践しております。

なお、当社の2023年7月末時点のPBRは3.83倍となっており、株価についても意識した経営を継続いたします。

コーポレートガバナンス報告書(2023.11.6提出)より

ROEの実績(3期分)、計画(2期分)



$$\begin{array}{|c|} \hline \text{ROE} \\ \hline \text{(Return On Equity)} \\ \text{自己資本当期純利益率} \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline \text{PER} \\ \hline \text{(Price Earnings Ratio)} \\ \text{株価収益率} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{PBR} \\ \hline \text{(Price Book-value Ratio)} \\ \text{株価純資産倍率} \\ \hline \end{array}$$

コーポレートガバナンス報告書は[こちら](#)

株主・投資家との対話状況

基本方針

当社は、持続的な企業価値の向上のために、株主との間で建設的な対話を行うこととしております。株主との対話につきましては、代表取締役社長 川邊 史の管掌の下、専任部署である広報・IR室(2024年1月現在3名)を中心に、経理部、総務部、社長室などの関連部署と密接に連携しつつ、IR活動を行っています。また、対話に際しては内部規定に基づき未公表のインサイダー情報の管理を徹底しております。

対話を行った株主の概要 対象期間:2022年8月1日から2023年7月31日までの1年間

【機関投資家・アナリスト向け】

- ・1 on 1 ミーティング 118件(国内100件、海外18件)
- ・スモールミーティング 年5回
- ・機関投資家・アナリスト向け オンライン決算説明会 年2回(Zoomウェビナー形式/中間3月、期末9月)

【個人投資家向け】

- ・株主総会後の会社説明会 年1回(10月)
- ・第44期年次報告書にて株主アンケートを実施
- ・個人投資家からの電話・メール問い合わせ対応 随時

その他、対話の実例、取締役会に対するフィードバック、取り入れた事項などはHPに掲載 ⇒ 株主・投資家との対話状況の詳細は[こちら](#)

株主アンケート結果のご報告

＼株主の皆様の声をお聞かせください／
 **コエキク**

株主アンケート概要

第44期年次報告書にて御案内した株主アンケートには、多くの株主様からご回答をいただき、厚く御礼を申し上げます。株主様から寄せられたご意見の一部をご報告いたします。いただきました貴重なご意見を今後の事業活動に活かしてまいります。

【調査対象】 全株主様

【株 主 数】 8,158名 (2023年7月31日時点)

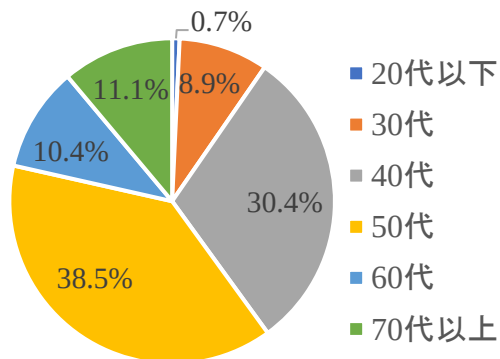
【調査方法】 第44期年次報告書のQRコードより、株式会社プロネクサスが提供する『コエキク』機能にてご回答をいただきました。

【集計期間】 2023年10月24日～11月30日

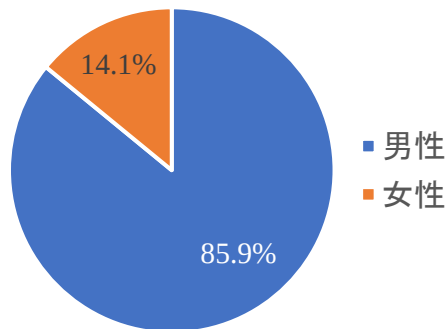


株主アンケート結果 ①

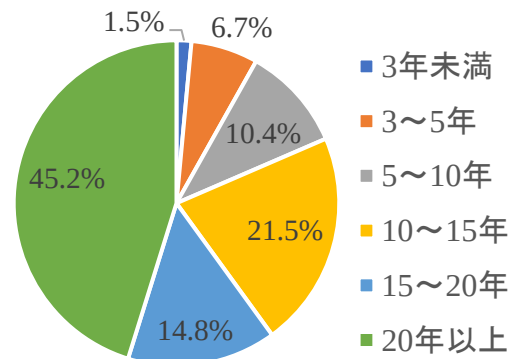
あなたの年齢をお知らせ
ください。



あなたの性別をお知らせ
ください。

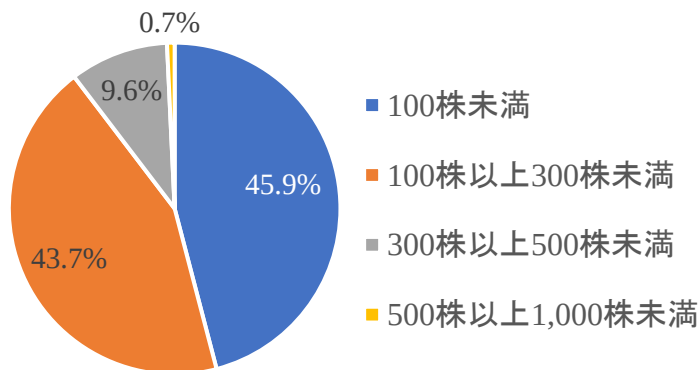


株式投資を始めて
どのくらいになりますか。

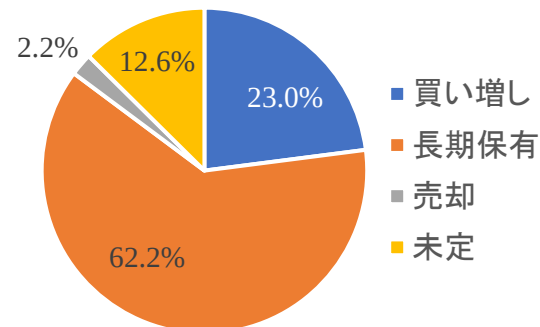


株主アンケート結果 ②

当社の保有株式数について
教えてください。

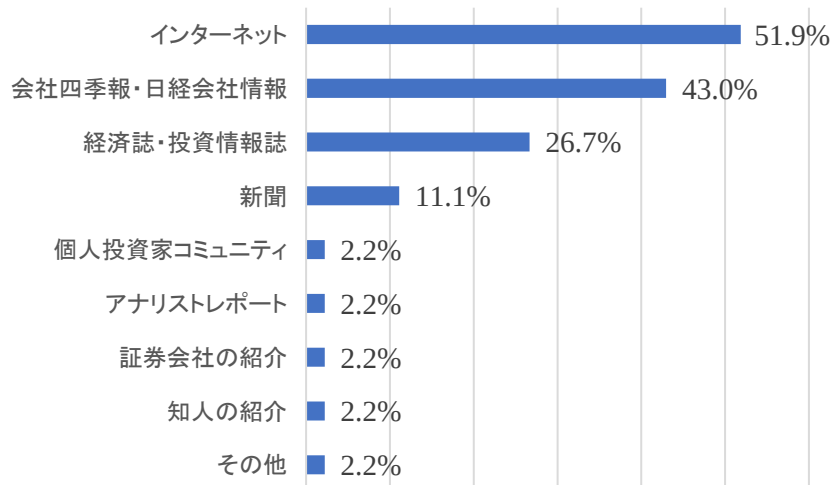


当社の株式に対して
どのような方針ですか？

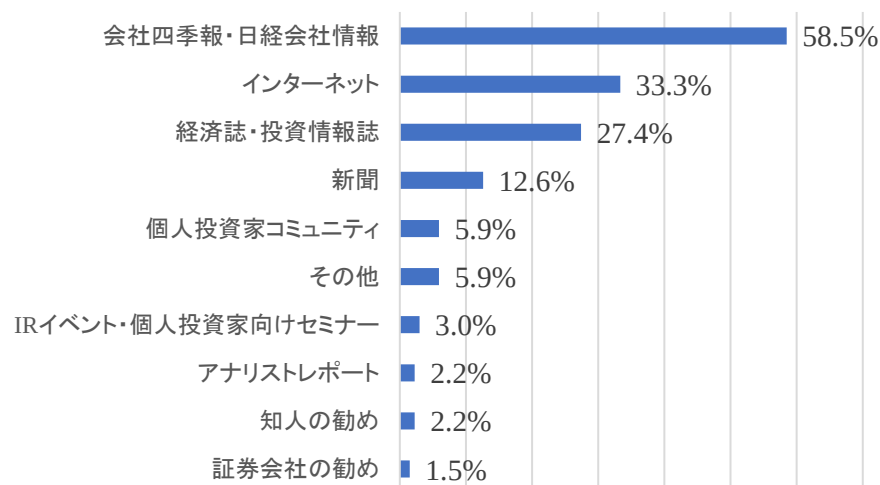


株主アンケート結果 ③

当社をどこで知りましたか？ (複数選択可)

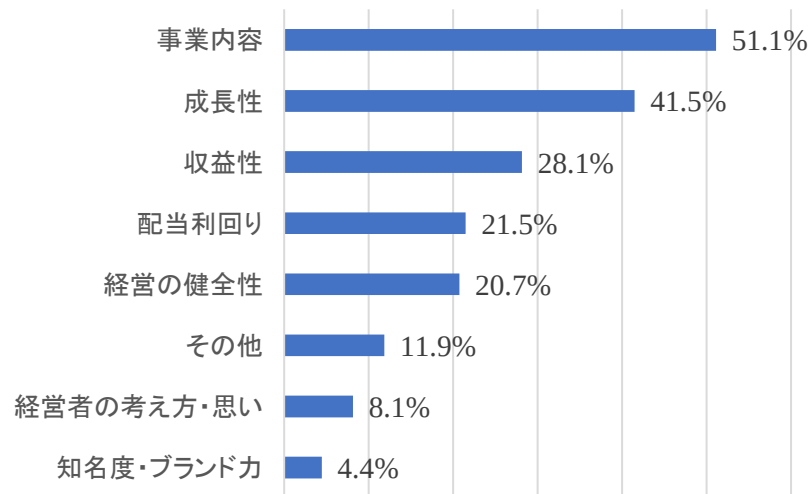


当社への投資を決める際に参考にした 情報源は何ですか？(複数選択可)

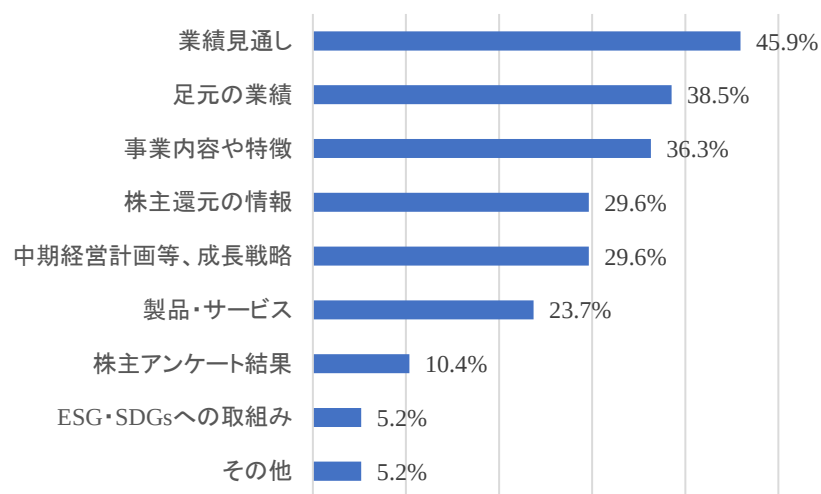


株主アンケート結果 ④

当社に投資する決め手となったポイントは何ですか？（複数選択可）



今後、年次報告書への記載を希望または充実してほしい情報は何ですか？（複数選択可）



株主アンケート結果 ⑤

ご意見・ご要望（株主様より頂戴しましたご意見・ご要望を一部抜粋して記載しております）

- 次代を先見し、益々、業容の拡充に努められますよう、ご期待します。(70代以上、男性)
- 社会貢献もしっかりされているので良いと思います。(50代、女性)
- 株主還元方針と企業価値向上策について詳しく知りたい。(50代、男性)
- 株主還元施策のさらなる充実をお願いします。(30代、男性)
- 配当金をありがとうございます。増配を頑張って株主還元願います。(30代、男性)
- 安定成長と株主還元を期待します。(50代、男性)
- 過去最高の売上、営業利益、純利益を達成され素晴らしい業績ですね。皆様の努力あってのものと嬉しく思いました。なお一層のご発展を願っております。(70代以上、女性)
- しっかり利益の出る体質になったのは、素晴らしいです。ますますの発展を期待してます。(50代、男性)
- 技術力のある会社が関西で活躍されることが嬉しいです。引き続きよろしくお願いします。(40代、男性)

株主アンケート結果 ⑥

ご意見・ご要望（株主様より頂戴しましたご意見・ご要望を一部抜粋して記載しております）

- いい人材の確保が会社の成長につながると考えます。人材に対する投資をお願いします。（30代、男性）
- 日本の技術力の成長を担っていただく会社として、とても期待しております。一つ要望があるとすれば、女性の方が役員にいらっやらないようなので、今後、そうした方も育成して行っていただけることを期待しております。（50代、女性）
- グローバルに事業展開、と言われてもイメージしづらいので、日常にどう関わっているか身近な事業内容の説明に興味を持ちます。（50代、女性）
- アンケート付きプレゼント企画は今後も継続してほしい。（40代、男性）
- これからも社員一丸となって頑張っていたきたいです。（50代、男性）

今後も株主の皆様とのより良いコミュニケーションの実現を目指し、定期的にアンケートを実施していきたいと考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

IRカレンダー



お問い合わせ

サムコ 株式会社

広報・IR室

E-mail : koho@samco.co.jp

URL : www.samco.co.jp



Better Tomorrow Driven by Thin Film Technology

参考資料

会社概要

商 号	サムコ株式会社 Samco Inc.
代 表 者	代表取締役会長 兼 CEO 辻 理(つじ おさむ) 代表取締役社長 兼 COO 川邊 史(かわべ つかさ)
設 立	1979年(昭和54年)9月1日
本社所在地	〒612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町36
事 業 内 容	半導体等電子部品製造装置の製造及び販売
売 上 高	78億3,059万円(2023年7月期)
従 業 員	175名(2024年1月)
証 券 コード	6387(東京証券取引所 プライム市場)



左:川邊 史、右:辻 理



最新の会社案内は[こちら](#)



当社のビジネスモデルは[こちら](#)

沿革(創業～2010年)

1979年9月	半導体製造装置の製造及び販売を目的として株式会社サムコインターナショナル研究所を設立
1980年7月	半導体プロセス用大型CVD(Chemical Vapor Deposition)装置の開発、販売を開始
1984年7月	東京都品川区に東京出張所(現東日本営業部)を開設
1987年2月	米国カリフォルニア州にオプトフィルムス研究所を開設
1997年11月	麒麟ビール株式会社と共同で、プラスチックボトルにDLC(ダイヤモンド・ライク・カーボン)膜を形成する技術を開発
2001年5月	日本証券業協会に株式を店頭上場
2004年12月	株式会社サムコインターナショナル研究所からサムコ 株式会社へ社名を変更
2010年4月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場(2013年7月より東京証券取引所JASDAQ(スタンダード))に上場



沿革の詳細は[こちら](#)

沿革(2011年～現在)

2013年7月	東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)から市場第二部へ市場変更
2014年1月	東京証券取引所市場第二部から同第一部銘柄に指定
2014年5月	リヒテンシュタイン公国UCP Processing Ltd.の株式90%を取得し子会社化(samco-ucp AGに社名変更)
2016年9月	Aqua Plasmaを用いたプラズマ洗浄装置AQ-2000の開発、販売を開始
2020年7月	第二生産技術棟内にCVD装置のデモルームを開設
2021年12月	電子デバイス製造向けクラスターツールシステム「クラスターH TM 」の販売を開始
2022年3月	第二研究開発棟内にナノ薄膜開発センターを立ち上げ
2022年4月	東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場へ移行



沿革の詳細は[こちら](#)

国内拠点、海外拠点



京都地区



本社



研究開発センター



第二研究開発棟



製品サービスセンター



生産技術研究棟



第二生産技術研究棟



海外営業・サービス拠点(計11拠点)

海外売上高比率34.3%(2023年7月期実績)

現地の営業・サービス人員を強化し、海外市場の開拓を図る。

⇒インド・ベンガルールオフィスを開設(2022年7月)

各事業拠点の詳細は[こちら](#)

製品ラインナップ



deposition

■CVD (Chemical Vapor Deposition) 装置

- ALD (Atomic Layer Deposition) 装置
- プラズマCVD装置
- 液体ソースCVD®装置



etching

■ドライエッチング装置

- ICP (Inductively Coupled Plasma) エッチング装置
- シリコン深掘り装置
- RIE (Reactive Ion Etching) 装置



surface
treatment

■ドライ洗浄装置

- Aqua Plasma® クリーナー
- プラズマクリーナー
- UVオゾンクリーナー

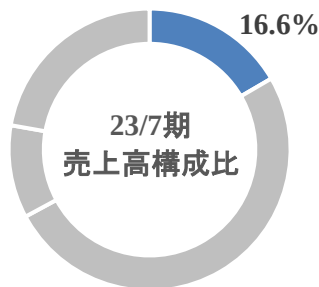


品目別売上高 CVD装置



装置ラインナップ

- ・ALD (Atomic Layer Deposition) 装置
- ・プラズマCVD装置
- ・液体ソースCVD®装置



概要

反応性の気体を基板上に供給し、化学反応によって薄膜を形成する装置で、一般に半導体、電子部品製造のための半導体膜、絶縁膜、金属膜などを形成するために使われます。当社が開発したLS (Liquid Source)-CVD装置では、引火爆発性のあるガスを使用せず安全性に優れた液体原料を用いて、低温で均一性に優れた薄膜を高速で形成することが可能です。

2015年12月から販売を開始した原子層堆積装置 (ALD = Atomic Layer Deposition) はCVD装置に分類しております。ALD装置は、反応室に有機金属原料と酸化剤を交互に供給し、表面反応のみを利用して成膜を行う装置であり、高い膜厚制御性と良好な段差被覆性を実現することが可能です。

第44期有価証券報告書(2023.10.24提出)より



CVD装置の詳細は[こちら](#)



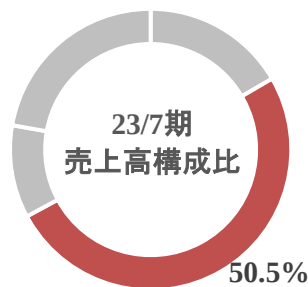
CVD装置とは [⇒こちら](#)
(半導体製造装置入門より)

品目別売上高 エッチング装置



装置ラインナップ

- ・ICP (Inductively Coupled Plasma) エッチング装置
- ・シリコン深掘り装置
- ・RIE (Reactive Ion Etching) 装置
- ・XeF₂ドライエッチング装置



概要

各種半導体基板上の半導体薄膜、絶縁膜をはじめ微細加工が必要な材料をドライ加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻いたします。当社独自のトルネードICP(Inductively Coupled Plasma＝高密度プラズマ)を利用するエッチング装置では、高密度プラズマを安定して生成し、高速で高精度の微細加工が可能です。

第44期有価証券報告書(2023.10.24提出)より



エッチング装置の詳細は[こちら](#)



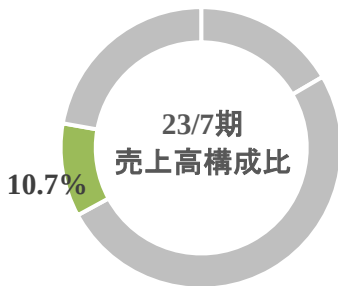
エッチング装置とは ⇒ [こちら](#)
(半導体製造装置入門より)

品目別売上高 洗浄装置



装置ラインナップ

- ・Aqua Plasma[®] クリーナー
- ・プラズマクリーナー
- ・UVオゾンクリーナー



概要

実装基板や各種半導体基板などを溶液を用いずドライ洗浄する装置で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて処理する装置や紫外線と高濃度オゾンの併用で処理する装置などがあります。当社のドライ洗浄装置は、ウェット洗浄では難しい超精密洗浄を高効率で行うことが可能であります。

2016年9月より販売を開始した水蒸気(H₂O)を用いたプラズマ処理装置であるAqua Plasma(アクアプラズマ)洗浄装置は、金属酸化膜の還元、有機汚れの洗浄、樹脂接合、超親水化などの表面処理を、安全で環境に優しく行うことが可能であります。 第44期有価証券報告書(2023.10.24提出)より



洗浄装置の詳細は[こちら](#)



洗浄装置とは [⇒こちら](#)
(半導体製造装置入門より)

品目別売上高 部品・メンテナンス

主な内訳

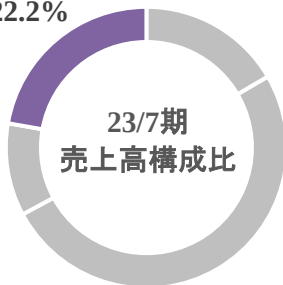
- ・部品、消耗品
- ・修理、改造
- ・移設、作業
- ・メンテナンス

概 要

当社装置の納品後のアフターサービスに係る売上を、部品・メンテナンスの売上高として計上しております。交換用の部品や消耗品をはじめ、装置の修理や改造、また装置の移設やそれに伴う作業費、メンテナンス費用等があります。

第44期有価証券報告書(2023.10.24提出)より

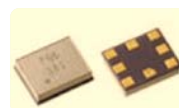
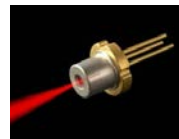
22.2%



旧用途別売上高区分 当第1四半期決算までの区分

用 途	概 要
オプトエレクトロニクス分野	主に化合物半導体から作られるLED (Light Emitting Diode＝発光ダイオード) やマイクロLED、LD (Laser Diode＝半導体レーザー)、面発光レーザー (VCSEL) などの発光デバイスのほか、電気信号を光信号に変換したり、逆に光信号を電気信号に変換したりする光通信用デバイスなどに関する分野。
電子部品分野	パワーデバイス・高周波デバイス・各種センサー・MEMS (Micro Electro Mechanical Systems＝微小電気機械素子) ・SAW (Surface Acoustic Wave＝弾性表面波) デバイス・量子デバイスなどに関する分野。
シリコン分野	三次元LSI (Large Scale Integrated circuit) ・三次元パッケージやウェハー欠陥解析などに関する分野。
実装・表面処理分野	ICのパッケージングの洗浄や表面処理に関する分野であります。高密度実装に対応するために基板はますます小型化、薄型化、多ピン化しており、高度な洗浄機能が要求されております。
表示デバイス分野	有機EL (Electro Luminescence)、LCD (Liquid Crystal Display＝液晶表示素子)、VR (Virtual Reality) ディスプレイなどに関する分野。
その他分野	上記以外の分野。
部品・メンテナンス	部品・メンテナンスに関する分野。

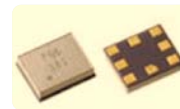
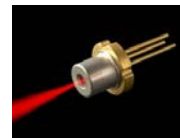
第44期有価証券報告書(2023.10.24提出)より



用途別売上高区分

当第2四半期決算より区分を変更しております

用 途	概 要
化合物半導体分野	GaN(窒化ガリウム)、GaAs(ガリウムヒ素)、InP(インジウムリン)、SiC(炭化シリコン)などの化合物を材料に用いた半導体デバイスの加工用途です。化合物半導体はLEDや半導体レーザーといった光デバイス、電力の制御や増幅に使われるパワーデバイスや高速通信を実現するHEMT(High Electron Mobility Transistor)などの高周波デバイスに用いられます。
シリコン半導体分野	シリコンウェハの欠陥解析及びシリコン半導体に関する加工用途です。
電子部品分野	半導体を除く電子部品の加工用途です。主にMEMS(Micro Electro Mechanical Systems 微小電気機械システム)、コンデンサ、インダクタ、各種センサー、高周波フィルターが含まれます。
ヘルスケア関連分野	マイクロ流体デバイスなどヘルスケアに関する加工用途などです。
その他	大学等の共用設備向けの装置など上記以外の加工用途です。
部品・メンテナンス	部品・メンテナンスに関する売上であります。



第45期第2四半期 決算短信(2024.3.13提出)より

当社製品が用いられるアプリケーション(例)



MEMS



TSV



SiCパワーデバイス



GaNパワーデバイス



LED

様々なアプリケーションの製造工程に
当社の製品が使用されています。



半導体レーザ(LD)



光導波路



フォトニック結晶



GaAs高周波デバイス



SAWデバイス

事業領域 化合物半導体の例

化合物半導体は、複数の異なる元素を組み合わせて作ること、シリコンのような単元素の半導体では実現できない特性を得ることができます。

高速で動作する、高い耐熱性、低消費電力、発光するなどの優れた特性を持っており、スマートフォンの高周波デバイスやLD、LED、次世代パワーデバイスなどの材料として利用されています。

デバイスの例	材料の例	最終製品・用途の例
LD(半導体レーザー)	GaAs、InGaAsP、InP	スマートフォン顔認証システム、自動車の自動運転システム、無線基地局・衛星、光通信
LED、マイクロLED	GaN、AlInGaP、GaP	液晶ディスプレイ、照明、自動車ヘッドライト
パワーデバイス	SiC、GaN、Ga ₂ O ₃	鉄道車両インバーター、電気自動車の充電ユニット、データセンター、ノートパソコン等の急速充電器

地域別売上高区分

当社では、当社の製品が使用される地域(国)によって、売上高を以下の地域に区分しております。

地 域	対象となる国
日 本	日本国内
アジア	台湾、中国、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、インド ほか
北 米	米国、カナダ、メキシコ
欧 州	ブルガリア、ドイツ、イギリス、フィンランド、ポルトガル、スペイン、イタリア、トルコ ほか
その他	オーストラリア、エジプト ほか

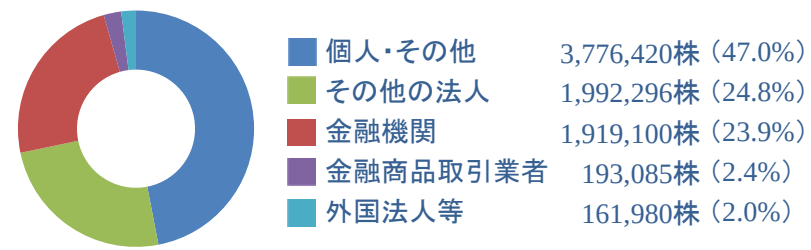
当社 第44期有価証券報告書(2023.10.24提出)より

株式の状況（2024年1月末時点）

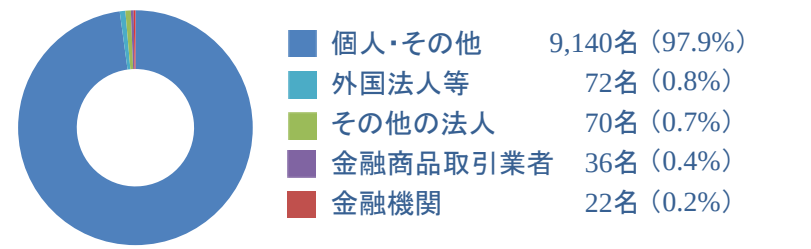
- ・発行可能株式総数 14,400,000株
- ・発行済株式の総数 8,042,881株
- ・株主数 9,340名
- ・大株主の状況

株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
一般財団法人サムコ科学技術振興財団	1,000,000	12.4
辻 理	863,707	10.7
サムコエンジニアリング株式会社	850,282	10.6
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	665,600	8.3
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	377,300	4.7
辻 一美	201,465	2.5
野村信託銀行株式会社(投信口)	161,000	2.0
株式会社三菱UFJ銀行	129,600	1.6
サムコ従業員持株会	104,738	1.3
立田 利明	103,099	1.3

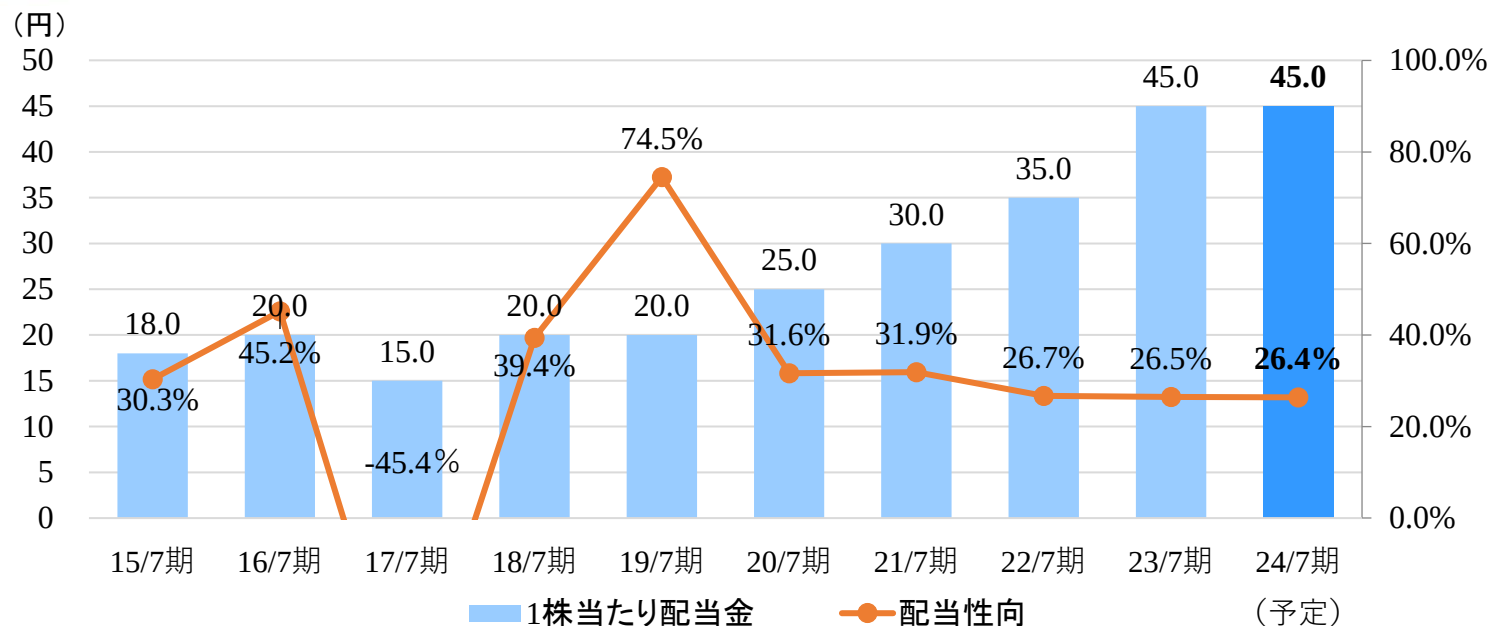
・所有者別株式分布状況(株式数ベース)



・所有者別株式分布状況(株主数ベース)



1株当たり配当金、配当性向 推移



経営体質の強化と研究開発のための設備投資等のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続する基本方針のもと、余剰資金については業績連動的な配当の考え方を合わせて取り入れております。

ESG・サステナビリティ



持続可能な社会の実現に向けて サムコの取り組み

経営理念 ～薄膜技術で世界の産業科学に貢献する～

E 環境

《気候変動・脱炭素への取り組み》

- ・TCFD提言に基づいた情報開示。ESG委員会の活動による気候変動への対応状況把握、対策。
- ・環境方針(2006年制定)に沿った取り組みを実施。

《環境配慮型製品》

- ・省エネ・脱炭素を支えるLED、次世代パワーデバイスの製造などを支える装置メーカー。
- ・コア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに世界中の製造現場や研究者へ装置を提供。
- ・主な取り組みテーマ ①製品容積の減少、②消費エネルギーの削減、③会社消費電力量の削減、④グリーン調達、⑤廃棄物の削減

S 社会

《事業を通じた社会的価値の創造》

- ・顧客価値、取引先価値、社会的価値、株主価値、従業員価値の創造

《社会貢献、地域貢献》

- ・サムコ科学技術振興財団による若手研究者への支援活動
- ・京都工繊繊維大学への寄附講座
- ・従業員、会社からの寄付金活動。(日本赤十字社、京都大学ほか／ウクライナ支援、トンガ大津波支援)

G ガバナンス

《ガバナンス体制、ダイバーシティ》

- ・役員11名中、社外役員5名
- ・取締役会の実効性評価による改善、検討。
- ・多様な人材確保。(女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

当社が重点的に取り組むSDGs



上記の取り組みに限らず、様々なチャレンジを続けることで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

各取り組みの詳細は[こちら](#)

サステナビリティに関する取り組み

取り組みテーマ	概 要
製品容積の減少	半導体製造装置の製造現場では、多大な電力を要するクリーンルームでの効率的な装置配置が不可欠です。そのためには、フットプリントの削減が重要なポイントとなります。更に小さなサイズの装置とすることで納品時における移送コストの削減を行うことができます。
消費エネルギーの削減	より少ない電力消費で当社装置を稼働できるよう省電力が可能となる部品の選択や構成の見直しなどを恒常的に行ってまいります。
会社消費電力量の削減	当社業務活動における電力消費、温室効果ガスの排出量削減を目指した取り組みを行ってまいります。
グリーン調達	当社では、環境に配慮した原材料・部品を優先的に調達するグリーン調達を、調達先企業と協力して推進しております。
廃棄物の削減	事業活動に伴い排出される廃棄物の量の削減・リサイクル製品の利用促進に継続的に取り組んでおります。

各取り組みの詳細は[こちら](#)

TCFD対応

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)



G20財務大臣・中央銀行総裁会議の要請を受け、金融安定理事会(FSB)により2015年12月に設立された「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略称。

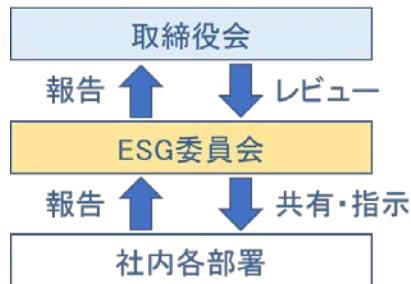
「ESG委員会」より、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標について当社ホームページ上で開示。

ESG委員会

気候変動に係るリスク及び機会、自社の事業活動や収益に与える影響についてのデータ収集と分析を行うため、代表取締役社長を委員長とする「ESG委員会」設置。

⇒活動内容を取締役に年1回以上報告

⇒財務への影響や中長期経営計画への影響等に対する検討を行う。



各取り組みの詳細は[こちら](#)

省エネ、脱炭素社会実現を支えるサムコの技術



サムコの“薄膜技術”は省エネ・脱炭素を支えるLED、次世代パワーデバイスなどを支えています。

当社のコア技術である最先端の“薄膜技術”をベースに、SDGsに関連する環境・社会・ガバナンスの視点から研究開発、人材育成に注力。

最先端の製造装置を世界中の製造現場や研究者へ提供し、省エネ、脱炭素社会の実現に貢献していきます。

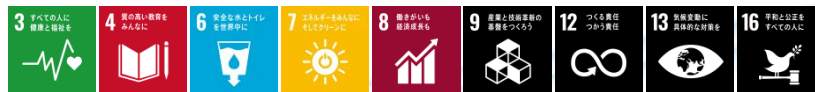
サムコとSDGsの関わり

- ・当社の主な事業領域である半導体・電子部品製造装置事業は、SDGsの目標を達成するためには欠かせない技術です。
- ・SDGsの17の目標では、経済、産業、社会等の課題を取り扱っていますが、当社では、創業以来、「企業の永続的な発展を追究し、適正な利益を確保することにより、企業を取巻く利害関係者と共に成長する企業を目指して、薄膜技術で世界の産業科学に貢献する。」という経営理念を掲げて、社会への貢献に重きを置いてきました。

事業との関連性が高い以下の項目について、重点的に取り組んでまいります。



サムコのSDGsの取り組み例



	・マイクロ流体チップ、医療用ドライ滅菌装置の製造に当社アクアプラズマ技術の寄与を目指す。 ・深紫外LED空気清浄機(コロナウィルス不活性化)製造に当社装置が寄与。 ・医療機器、エコーヘッドセンサーの製造に当社装置が寄与。 ・日本赤十字社への寄付。(ウクライナ支援、トンガ大津波支援等)
	・国内外の大学(ODA案件を含む)・研究機関等における医療分野や科学分野の研究のために、幅広く当社装置を提供。 ・サムコ科学技術振興財団を通じ、基礎・応用研究に携わる研究者を支援。 ・京都工芸繊維大学にサムコ辻理寄附講座「先端材料科学講座」を開講。
	・浄水場・家庭・職場・レストラン等での流水浄化用に水銀ランプの代替光源として、深紫外線LEDを利用した浄水器が製造。深紫外線LEDの製造に当社装置が寄与。
	・省エネの切り札である次世代パワーデバイスの材料として期待されるSiC(炭化シリコン)、GaN(窒化ガリウム)、酸化ガリウム(Ga_2O_3)等の加工に当社装置が寄与。 ・高効率LED素子、マイクロLEDや、LD(レーザー)の製造のほか、太陽電池の研究開発用で当社装置を提供。
	・当社はファブライツ企業として、サプライヤーや協力工場と協業し、双方の事業発展を目指す。 ・勤続年数に応じた表彰のほか、業績への貢献に応じた賞を用意。 ・役職ごとの当社独自の人材育成プログラムを実施。 ・多様な人材確保。(女性管理職の登用、外国籍社員の積極採用、中途採用含めた中核人材の多様性、シニア社員の活躍)

サムコのSDGsの取り組み例



	産業と技術革新の基盤造りのため、以下の用途等に装置を提供 ・5G関連の高周波フィルター、高周波デバイスの製造やデータセンターなどVCSEL(面発光レーザー)を含む通信用LD(レーザー)用装置の製造。 ・自動運転用のセンシング技術(LiDAR)、各種センサーや宇宙衛星の探索用センサー機器の製造。 ・有機EL、マイクロLEDの製造。 ・超伝導デバイス、量子デバイスの研究開発用途。
	・人の健康や環境を守るために当社での製造過程、製品について適正な管理を実現する。 ・環境に調和するプロセス技術の開発と、製造から廃棄までを考慮した環境負荷軽減型の製品開発に努める。 ・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。
	・調達する原材料、部品について、環境影響を考慮するよう調達先に働きかけ、グリーン調達に注力。 ・エネルギーの効率的な利用および3Rに取り組む。 ・省エネルギー、省スペースを基本とした製品を通じて環境負荷を低減。
	・コーポレートガバナンス・コードに基づいた経営を実践。 ・管理職、新入社員を対象にしたコンプライアンス研修を定例的に実施。 ・コンプライアンス全体を統括する組織として代表取締役社長を委員長とする「内部統制委員会」を設置し、内部統制システムの構築、維持、向上を推進。

サムコの人材育成方針



1. 仕事は楽しく、面白くあるべきである。一所懸命に楽しく仕事をして、かつ面白い。そして良い結果がついてくる。そんな楽しく、面白い日々が日常である会社とする。
2. “学ぶ”を忘れない。学ぶことを常に念頭に置き、長きに渡り己を磨くことで自らの価値を高めてほしい。特に若手社員は30代までに能力向上に勤しむ癖をつけないといけない。
3. リスキリングにより第一線で活躍できるスキルを身に付けることにより、70歳まで働ける企業としていく。シニア社員が十分社会貢献できるよう再教育することを会社の使命と考える。
4. 外国籍社員の採用を増やし、若手社員の海外経験を増やすことによりグローバル人材の育成を図る。
5. 階層別の教育訓練制度(部長塾、課長塾、成長塾)を発展的に継続し、多角的な視野で経営管理できる人材の育成を図る。
6. たえず組織の新陳代謝を図り、新たな細胞(多様な人材)を積極的に登用していく。人事異動は社員の層を厚くし、組織を重層化する目的もあり、新たな能力の開拓につなげる。女性社員も大きな戦力として、管理職で活躍をしてもらえるように環境を整備する。



お問い合わせ

サムコ 株式会社

広報・IR室

E-mail : koho@samco.co.jp

URL : www.samco.co.jp



Better Tomorrow Driven by Thin Film Technology